# XP-002413299

```
(C) WPI / Thomson
    - 2002-746163 [81]
 AN
 AP - JP20010084831 20010323
 PR - JP20010084831 20010323
 TI - Method for preparation of cosmetics involves mixing cystine derivative
       with neutral solution of water-soluble carboxylic polymer and basic
       amino acid
 IW - METHOD PREPARATION COSMETIC MIX CYSTINE DERIVATIVE NEUTRAL SOLUTION
       WATER SOLUBLE CARBOXYLIC POLYMER BASIC AMINO ACID
 IN - IMORI Y
 PA - (AJIN ) AJINOMOTO KK
 PN - JP2002284619
                            A 20021003 DW200281
 PD - 2002-10-03
 IC - A61K7/00
 DC - D21 E16
 AB - NOVELTY:
       Method for preparation of cosmetics containing cystine derivative and
       basic amino acid comprises:
       (i) mixing an anionic water-soluble polymer containing a carboxylic
       group with a basic amino acid in aqueous medium to cause
       neutralization and
       (ii) mixing the neutralized solution with cystine derivative (I).
     - DETAILED DESCRIPTION :
       Method for preparation of cosmetics containing cystine derivative and
       basic amino acid comprises:
       (i) mixing an anionic water-soluble polymer containing a carboxylic
       group with a basic amino acid in aqueous medium to cause
       neutralization and
       (ii) mixing the neutralized solution with a cystine derivative of
       formula (I).
       [Image]
       R<1>and R<3>H, aminocarbonyl, alkyl, acyl, hydroxyalkyl or
       alkoxy-2-hydroxypropyl;
       X and Y : H or alkyl;
      m and n: 0-5;
       A and B : -O- or -NH-;
       R<2> and R<4>alkyl, hydroxyalkyl or alkoxy-2-hydroxypropyl.
     - USE :
       Cosmetics.
     - ADVANTAGE :
      No bad smell is caused.
```

Page 1



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-284619 (P2002-284619A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

餓別記号 (51) Int.Cl.<sup>7</sup> A61K 7/00

FI A61K 7/00 ァーマコート\*(参考)

C 4C083

K M

N

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全 6 頁)

特願2001-84831(P2001-84831) (21)出顧番号

平成13年3月23日(2001.3.23) (22) 出願日

(71)出願人 00000066

味の素株式会社

東京都中央区京橋1丁目15番1号

(72) 発明者 伊森 義久

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の

素株式会社アミノサイエンス研究所内

(74)代理人 100085109

弁理士 田中 政浩

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 化粧料の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、不快臭を 発生させずに配合するための化粧料の製造方法の提供。 【解決手段】 下記一般式(I)で表されるシスチン誘導 体と塩基性アミノ酸とを含有する化粧料の製造方法にお

いて、第1段階として分子中にカルボキシル基を含有す るアニオン性水溶性高分子と塩基性アミノ酸を水性媒体 中で混合して中和させ、第2段階として該シスチン誘導 体を混合する。

$$R^{7}-NH-CH-(CX_{2})_{n}$$
 -S-S-(CY<sub>2</sub>)<sub>ni</sub>-CH-NH-R<sup>3</sup>

$$CO-A-R^{2}$$

$$CO-B-R^{4}$$
(1)

(式中、R 1 及びR 2 は水素原子、アミノカルボニル 基、アルキル基、アシル基、ヒドロキシアルキル基、又 は3-アルコキシー2-ヒドロキシプロビル基を表し、 2個のX及び2個のYは水素原子又はアルキル基を、n

及びmは0~5の整数を表す。A及びBは-O-又は-NH-を表し、R2及びR4は水素原子、アルキル基、 ヒドロキシアルキル基、又は3-アルコキシー2-ヒド ロキシブロビル基を表す。)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)にて表されるシスチン 誘導体と塩基性アミノ酸を含有する化粧料を製造する方 法において、第1段階として分子中にカルボキシル基を 含有するアニオン性水溶性高分子と塩基性アミノ酸を水

(式中、R1 及びR3 はそれぞれ独立に水素原子、アミ ノカルボニル基、炭素原子数1~22のアルキル基、炭 素原子数2~22のアシル基、炭素原子数1~22のヒ ドロキシアルキル基、またはアルコキシル基の炭素原子 数が1~22の3-アルコキシー2-ヒドロキシブロビ ル基を表し、2個のN及び2個のYはそれぞれ独立に水 素原子または炭素原子数1~6のアルキル基を、そして n及びmはそれぞれ独立に0~5の整数を表す。A及び Bはそれぞれ独立に一〇一または一NHーを表し、R2 及び日4はそれぞれ独立に水素原子、炭素原子数1~2 2のアルキル基、炭素原子数1~22のヒドロキシアル キル基、またはアルコキシル基の炭素原子数が1~22 の3-アルコキシー2-ヒドロキシプロピル基を表

(式中、R1及びR3はそれぞれ独立に水素原子、アミ ノカルボニル基、炭素原子数1~22のアルキル基、炭 素原子数2~22のアシル基、炭素原子数1~22のヒ ドロキシアルキル基、またはアルコキシル基の炭素原子 数が1~22の3-アルコキシー2-ヒドロキシブロビ ル基を表し、2個のN及び2個のYはそれぞれ独立に水 素原子または炭素原子数1~6のアルキル基を、そして n及びmはそれぞれ独立に0~5の整数を表す。A及び Bはそれぞれ独立に一〇一または一NHーを表し、R2 及びR4 はそれぞれ独立に水素原子、炭素原子数1~2 2のアルキル基、炭素原子数1~22のヒドロキシアル キル基、またはアルコキシル基の炭素原子数が1~22 の3-アルコキシー2-ヒドロキシブロピル基を表 す。)

#### [0003]

【従来の技術】上記一般式(Ⅰ)表示のシスチン誘導体 として、例えばN、N'ージアセチルシスチンジメチル エステルは抗酸化作用や美白作用など皮膚化粧料として 有効な効果をもつことが知られている。しかしながら、 上記一般式(I)表示のシスチン誘導体を含む処方中に 塩基性物質として塩基性アミノ酸を含む場合、不快臭を 発生するため、使用できる化粧品に制限があった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 一般式(I)表示のシスチン誘導体と塩基性アミノ酸 を、不快臭の発生を伴わずに化粧料基材に配合してなる 性媒体中で混合して中和させ、第2段階として下記一般 式(I)にて表されるシスチン誘導体を混合することを 特徴とする化粧料の製造方法。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
(2)_{m} - CH - NH^{3} - R^{3} \\
\hline
(1) \\
CO - B - R^{4}
\end{array}$$

す。)

【請求項2】 請求項1記載の方法によって製造された 化粧料にユーカリエキス、1-メントール及びd 1-カ ンフルから選ばれた不快臭防止成分の一種又は二種以上 を更に配合してなる化粧料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は下記一般式(1)に て表されるシスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、不快臭 を発生させずに配合してなる化粧料の製造方法に関す *Z*o ...

化粧料の製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らはかかる事情 に鑑み鋭意研究の結果、第1段階として分子中にカルボ キシル基を含有するアニオン性水溶性高分子(以下、 「カルボキシル基含有アニオン性高分子」と略記する)

と塩基性アミノ酸を十分に混合して中和させ、第2段階 として上記一般式(I)表示のシスチン誘導体を混合す ることにより、該シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、 不快臭を発生させずに配合できることを見出し、本発明 を完成するに至った。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳述する。 本発明に用いられる上記一般式(I)表示のシスチン誘導 体において、RIおよびR3としては、例えば、水素原 子、アミノカルボニル基、アセチル基、プロピオイル 基、イソプロピオル基、カーブチロイル基、イソブチロ イル基、secーブチロイル基、tertーブチロイル 基、nーアミロイル基、secーアミロイル基、ter t-アミロイル基、イソアミロイル基、n-ヘキシロイ ・ル基、シクロヘキシロイル基、nーヘプタノイル基、n ーオクタノイル基、2-エチルヘキシロイル基、ノニオ イル基、イソノニオイル基、デカノイル基、イソデカノ イル基、ウンデカノイル基、ラウロイル基、トリデカノ イル基、イソトリデカノイル基、ミリストイル基、パル ミトイル基、イソパルミトイル基、ステアロイル基、イ

ソステアロイル基、オレオイル基、ドコサノイル基、メ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、secープチル基、tert ープチル基、nーアミル基、secーアミル基、ter t-アミル基、イソアミル基、n-ヘキシル基、シクロ ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、2-エ チルヘキシル基、ノニル基、イソノニル基、デシル基、 イソデシル基、ウンデシル基、ラウリル基、トリデシル 基、イソトリデシル基、ミリスチル基、セチル基、イソ セチル基、ステアリル基、イソステアリル基、オレイル 基、ペペニル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロ キシプロピル基、2-ヒドロキシイソプロピル基、2-ヒドロキシーカーブチル基、2-ヒドロキシイソブチル 基、2ーヒドロキシーsecーブチル基、2ーヒドロキ シーtertーブチル基、2-ヒドロキシーn-アミル 基、2-ヒドロキシーsecーアミル基、2-ヒドロキ シーtertーアミル基、2-ヒドロキシイソアミル 基、2-ヒドロキシーn-ヘキシル基、2-ヒドロキシ シクロヘキシル基、2-ヒドロキシーn-ヘプチル基、 2-ヒドロキシーカーオクチル基、2-ヒドロキシー2 -エチルヘキシル基、2-ヒドロキシノニル基、2-ヒ ドロキシイソノニル基、2-ヒドロキシデシル基、2-ヒドロキシイソデシル基、2-ヒドロキシウンデシル 基、2-ヒドロキシラウリル基、2-ヒドロキシトリデ シル基、2-ヒドロキシイソトリデシル基、2-ヒドロ キシミリスチル基、2-ヒドロキシセチル基、2-ヒド ロキシイソセチル基、2-ヒドロキシステアリル基、2 - ヒドロキシイソステアリル基、2-ヒドロキシオレイ ル基、2-ヒドロキシベヘニル基、3-メトキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-エトキシー2-ヒドロキシ プロピル基、3ープロピオキシー2ーヒドロキシプロピ ル基、3ーイソプロピオキシー2ーヒドロキシプロピル 基、3-n-ブトキシー2-ヒドロキシプロピル基、3 - イソブトキシー 2-ヒドロキシプロビル基、3-se cープトキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーter ナープトキシー2-ヒドロキシプロビル基、3-n-ア ミルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-sec-アミルオキシー2ーヒドロキシブロビル基、3-ter セーアミルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーイ ソアミルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-n-ヘキシルオキシー 2-ヒドロキシプロビル基、3-シク ロヘキシルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3-n - ヘプチルオキシー 2 - ヒドロキシプロビル基、3 - n - オクチルオキシー2-ヒドロキシブロビル基、3-・(2-エチルヘキシル)オキシー2-ヒドロキシブロビ ル基、3ーノニルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、 3-イソノニルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3 - デシルオキシー 2ーヒドロキシプロピル基、3ーイソ デシルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーウンデ シルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーラウリル

オキシー2ーヒドロキシブロピル基、3ートリデシルオ キシー2-ヒドロキシプロピル基、3-イソトリデシル オキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーミリスチルオ キシー2-ヒドロキシプロビル基、3-セチルオキシー 2-ヒドロキシプロピル基、3-イソセチルオキシー2 -ヒドロキシプロピル基、3-ステアリルオキシー2-ヒドロキシプロビル基、3-イソステアリルオキシー2 - ヒドロキシプロピル基、3-オレイルオキシー2-ヒ ドロキシプロピル基、または3-ベヘニルオキシー2-ヒドロキシプロビル基等を挙げることができる。 【0007】R2 およびR4 としては、例えば、水素原 子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、カーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、 tertープチル基、n-アミル基、sec-アミル 基、もertーアミル基、イソアミル基、nーヘキシル 基、シクロヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル 基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、イソノニル基、 デシル基、イソデシル基、ウンデシル基、ラウリル基、 トリデシル基、イソトリデシル基、ミリスチル基、セチ ル基、イソセチル基、ステアリル基、イソステアリル 基、オレイル基、ベヘニル基、2-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシプロビル基、2-ヒドロキシイソプ ロピル基、2ーヒドロキシーnーブチル基、2ーヒドロ キシイソブチル基、2-ヒドロキシーsecーブチル 基、2-ヒドロキシーtertーブチル基、2-ヒドロ キシーnーアミル基、2-ヒドロキシーsecーアミル 基、2-ヒドロキシーtert-アミル基、2-ヒドロ キシイソアミル基、2-ヒドロキシーn-ヘキシル基、 2-ヒドロキシシクロヘキシル基、2-ヒドロキシ-n -ヘプチル基、2-ヒドロキシ-n-オクチル基、2-ヒドロキシー2-エチルヘキシル基、2-ヒドロキシノ ニル基、2-ヒドロキシイソノニル基、2-ヒドロキシ デシル基、2-ヒドロキシイソデシル基、2-ヒドロキ シウンデシル基、2-ヒドロキシラウリル基、2-ヒド ロキシトリデシル基、2-ヒドロキシイソトリデシル 基、2-ヒドロキシミリスチル基、2-ヒドロキシセチ ル基、2-ヒドロキシイソセチル基、2-ヒドロキシス テアリル基、2-ヒドロキシイソステアリル基、2-ヒ ドロキシオレイル基、2-ヒドロキシベヘニル基、3-メトキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-エトキシー 2-ヒドロキシプロピル基、3-プロピオキシー2-ヒ ドロキシプロピル基、3-イソプロビオキシー2-ヒド ロキシプロピル基、3-n-ブトキシー2-ヒドロキシ プロピル基、3-イソブトキシー2-ヒドロキシプロピ ル基、3-secープトキシー2-ヒドロキシブロビル 基、3-tert-ブトキシー2-ヒドロキシプロビル 基、3-n-アミルオキシー2-ヒドロキシプロピル 基、3-sec-アミルオキシー2-ヒドロキシプロビ ル基、3-tert-アミルオキシー2-ヒドロキシブ ロビル基、3-イソアミルオキシー2-ヒドロキシプロ

ピル基、3-n-ヘキシルオキシー2-ヒドロキシブロ ピル基、3-シクロヘキシルオキシー2-ヒドロキシブ ロビル基、3-11-ヘプチルオキシー2-ヒドロキシブ ロビル基、3-n-オクチルオキシー2-ヒドロキシブ ロピル基、3-(2-エチルヘキシル)オキシー2-ヒ ドロキシブロピル基、3-ノニルオキシー2-ヒドロキ シプロビル基、3ーイソノニルオキシー2ーヒドロキシ プロピル基、3ーデシルオキシー2ーヒドロキシプロピ ル基、3-イソデシルオキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-ウンデシルオキシー2-ヒドロキシブロピル 基、3-ラウリルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、 3-トリデシルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3 ーイソトリデシルオキシー2-ヒドロキシプロビル基、 3-ミリスチルオキシー2-ヒドロキシプロビル基、3 - セチルオキシー 2 - ヒドロキシプロピル基、3 - イツ セチルオキシー2ーヒドロキシプロビル基、3ーステア リルオキシー2ーヒドロキシブロビル基、3ーイソステ アリルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーオレイ ルオキシー2-ヒドロキシブロビル基、3-ベヘニルオ キシー2ーヒドロキシプロピル基等を挙げることができ Z) ..

【〇〇〇8】上記一般式(1)表示のシスチン誘導体は、 光学活性体またはラセミ体の何れでもよいが、し体及び D L 体が好ましい。また、上記一般式(I)で表される化 合物は何らかの塩の形でも好適に使用でき、例として は、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、 硫酸塩、リン酸塩等無機酸との塩、メタンスルポン酸 塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、1-カンファースルホン酸塩、 酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、コハク酸塩、 マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、グリコール 酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、脂肪酸塩、リンゴ 酸塩、ピログルタミン酸塩等の有機酸塩、アスパラギン 酸、グルタミン酸等の酸性アミノ酸塩等を挙げることが できる。これらの塩は単独で、または二種以上を組み合 わせて使用してもよい。さらにまた、一種以上の塩と遊 離体を組み合わせて使用してもよい。

【0009】本発明において、上記一般式(1)表示のシスチン誘導体の配合量は特に制限されないが、上記した作用を製剤に持たせるには、全組成中に0.001重量%以上配合すればよく、好ましくは0.01~2重量%の範囲内で配合される。

【0010】塩基性アミノ酸としては、Lーアルギニン、Lーリジン、Lーヒスチジン等が挙げられる。塩基性アミノ酸の配合量は、特に限定されないが、通常0.01~5.0重量%程度である。

【0011】本発明において、不快臭を防止する目的で 先ず塩基性アミノ酸に作用させる、カルボキシル基含有 アニオン性高分子については、分子中にカルボキシル基 を含有し、水溶性のもの、あるいは水性媒体中でエマル

ジョンを形成するものであれば、特に限定されるもので はなく、例えば、アクリル酸、メタアクリル酸、マレイ ン酸等の不飽和カルボン酸のホモボリマー、コボリマ ー、アクリル酸/酢酸ビニルコポリマー等を例示するこ とができる。これらカルボキシル基含有アニオン性高分 子の中でも、特にアクリル酸、メタアクリル酸、メタア クリル酸アルキルのうち一種以上を主成分として構成さ れる重合体が好ましく使用される。このカルボキシル基 含有アニオン性高分子について代表的なものを商品名で 示せば、次のとおりである。すなわち、「カーボボール 940」、「カーボボール941」、「カーボボール9 34」、「カーボポールETD-2020」、「ペミュ レンTR-1」、「ペミュレンTR-2」、「ウルトレ ズ10」(いずれもB. F. Goodrich Che mical社製)や「ハイビスワコー104」、「ハイ ビスワコー105」(いずれも和光純薬工業社製)等が 挙げられる。カルボキシル基含有アニオン性高分子の配 合量は、使用感や目的とする粘度等によって適宜決めら れるが、一般的には塩基性アミノ酸の配合量の約80~ 120重量%である。

【0012】水性媒体中、塩基性アミノ酸にカルボキシル基含有アニオン性高分子を作用させたならば、引き続き上記一般式(I)表示のシスチン誘導体が混合される。塩基性アミノ酸を子め、カルボキシル基含有アニオン性高分子で中和させてから上記一般式(I)表示のシスチン誘導体を配合することにより、該シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を共存させたときに発生する不快臭を著しく軽減することができる。

【0013】本発明の方法によって製造された化粧料に、さらに、不快臭防止成分としてユーカリエキス、1ーメントール及び d 1 ーカンフルを適量配合すれば、不快臭を完全に防止することができる。これらの不快臭防止成分は天然で存在するものであっても合成品であってもかまわない。

【0014】更にまた、本発明に係る化粧料には、前記必須成分の他、通常の化粧料に用いられる水性成分、粉末、界面活性剤、油剤、保湿剤、アルコール類、pH調整剤、防腐剤、色素、酸化防止剤、増粘剤、香料等を必要に応じて適宜配合することができる。

## 【0015】

【実施例】次に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0016】(実施例1)上記一般式(I)表示のシスチン誘導体であるN、N、-ジアセチルシスチンジメチルエステルを用いて、表1に示す組成の美容液を製造し、製品の不快臭について評価した。美容液の製造方法は、表中のA成分、B成分、C成分をそれぞれ50℃に加熱して攪拌溶解させた後、A成分にB成分を加えて良く攪拌混合し、さら

にD成分を加えて良く撹拌混合することで行った。

【0017】表1から明らかなように、本発明の実施例 1は、必須成分であるカルボキシル基含有アニオン性高 分子を全く含まない試料(比較例1)と比較した場合は もとより、カルボキシル基含有アニオン性高分子を含ん でいても混合順序が異なる試料(比較例2、3)と比較 しても大きく不快臭が低減されていた。

[0018]

【表1】

حد			_	41		А
主	恣	44	(I)	<b>1</b> 'E	i	N

A B WAY I L'A						
成 分 名		比較例1	比較例2	比較例3	実施例1	
A	N, N' ージアセチル -					
	レーシスチンジメチル	0. 50	0. 50	0.50		
	エステル		1			
	Lーアルギニン				0. 30	
	精製水	24. 50	24. 50	24. 50	14.70	
В	Lーアルギニン	0. 30	0. 30			
	精製水	14. 7Ù	14. 70			
	カルボキシビニル			70.00	00 00	
	ポリマー 1%水溶液			30, 00	30. 00	
	N, N' ージアセチルー					
	Lーシスチンジメチル				0 50	
	エステル			<u>[</u>		
C	Lーアルギニン			0. 30		
	精 製 水			14. 70	24 50	
$ \cdot $	カルボキシビニル		30. 00			
<u> </u>	ポリマー*1%水溶液		30. 00			
D	精 製 水	残余	残余	残余	残余	
不快具の強さ		非常に強い	かなり強い	かなり強い	憩い	

注)\*カルボキシビニルボリマー:「ウルトレズ 10」(商品名、BF Goodrich 社)

【0019】(実施例2)上記一般式(1)表示のシスチン誘導体であるN、N'ージアセチルシスチンジメチルエステルを用いて、表2に示す組成のクリームを製造し、製品の不快臭について評価した。クリームの製造方法は、以下の順序で行った。

- 1. 表中のA~D成分をそれぞれ50℃に加熱して攪拌 溶解させる。
- 2. A成分とB成分をSOでまで加熱し、ホモミキサーで攪拌しながらA成分にB成分をゆっくり加えて乳化させる。
- 3.50℃まで冷却し、C成分を加えて良く攪拌混合し、その後D成分加えて良く攪拌混合する。さらにE成

分を加えて良く攪拌混合し製品とする。

【0020】表2から明らかなように、事前にカルボキシル基含有アニオン性高分子に対してアルギニン、ヒスチジン等の塩基性アミノ酸を混合させてからN、N'ージアセチルシスチンジメチルエステルを配合した実施例1及び2は、カルボキシル基含有アニオン性高分子に対して塩基性アミノ酸とN、N'ージアセチルシスチンジメチルエステルを一度に添加した比較例に比べ、不快臭が大きく低減されていた。

[0021]

【表2】

クリームの作成

, <i></i>	成	分名	比較例	実施例1	实施例?
¦—┰	750	カルボキシピニルボリマ -	0. 35	0. 35	0. 35
A 水祖成分	濃プリセリン	10. 00	10, 00	10.00	
	精製水	34. 65	34. 65	34. 65	
		菜 種 油	12. 00	12.00	12.00
- Maneta	ah inet/s	トリステアリン酸 ポリグリセリル	1. 00	1. 00	1. 00
В	油相成分	プレジデン	0. 50	0. 50	0. 50
1		ビタミンAパルミナート	0. 05	0. 05	0. 05
-		Lーアルギニン	0, 30	0. 30	0. 30
1		一とステジン	0.05	0. 05	0.05
		di-Poinシカルボン酸 ナトリウム液	0 50	0. 50	0. 50
		プラブデルリテン酸 ジョカーリーウェム	0. 10	0. 10	0. 10
С	流加剂	N. N' ージアセチルー Lーシスチンジメチル エスナル	0, 50		
1		トーニーゼリン	0.10		
		レーフラニン	0.10		
1		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.10		
]		福 製 水	残余	適量	適量
-		N, N' ージアセチルー Lーシスチンジメチル		0. 50	0. 50
D添加剤	エステル		0. 10	0.10	
	レーアラニン		0. 10	0.10	
		トー・レーケイジジ		0. 10	0.10
		清 製 水		残余	展余
<del>   -  -</del>		ューカリエキス			0. 10
E 腱香成分		ナーデーダジドール			0.001
	不快	奥の強さ	かなり強い	弱い	非常に弱い

## [0022]

【発明の効果】本発明により、塩基性アミノ酸を子めカルボキシル基含有アニオン性高分子で中和させてから上

記一般式(I)表示のシスチン誘導体を配合することにより、該シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を共存させたときに発生する不快臭を著しく軽減することができる。

## フロントページの続き

F ターム(参考) 4C083 AA111 AA112 AA122 AC122 AC422 AC581 AC582 AC612 AC642 AD091 AD092 AD531 AD532 AD572 AD622 CC01 CC04 CC05 DD23 DD31 EE06